PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02200680 A

(43) Date of publication of application: 08.08.90

(51) Int. CI C07D307/33 B01J 31/24 // C07B 61/00

(21) Application number: 01019751

(22) Date of filing: 31.01.89

(71) Applicant:

MITSUBISHI KASEI CORP

(72) Inventor:

WADA HIROSUKE HARA YOSHINORI YUZAWA YOUJIROU

(54) PRODUCTION OF GAMMA-BUTYROLACTONE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject compound under mild condition in high selectivity and efficiency by hydrogenating maleic acid and/or maleic anhydride in liquid phase using a ruthenium catalyst composed of a specific component.

CONSTITUTION: The objective compound is produced by hydrogenating maleic acid and/or maleic anhydride in liquid phase using a catalyst consisting of (a)

ruthenium, (b) an organic phosphine, (c) a conjugated base of an acid having a pKa value of <2 and (d) a chlorine containing compound selected from alkali metal chloride, alkaline-earth metal chloride, ammonium chloride, phosphonium chloride, primary-tertiary amine hydrochloride, quaternary ammonium hydrochloride, primary-tertiary phosphine hydrochloride and quaternary phosphonium hydrochloride. The reaction temperature is 50-250°C, especially 100-200°C.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-200680

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月8日

C 07 D 307/33 B 01 J 31/24 // C 07 B 61/00

Z 300

8017-4G

7822-4C C 07 D 307/32 F

審査請求 未請求 請求項の数 1

(全5頁)

60発明の名称

γープチロラクトンの製造法

20特 願 平1-19751

22出 願 平1(1989)1月31日

@発 明 者 和 田 啓 輔 神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

総合研究所内

72)発 明 者 則

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

総合研究所内

個発 明 者 羊二郎

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

総合研究所内

勿出 願 人 三菱化成株式会社

70代 理 人 弁理士 木 邑 林

原

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

1発明の名称

γ - プチロラクトンの製造法

2 特許請求の範囲

(1) マレイン酸及び/又は無水マレイン酸を触 媒の存在下で水素化することによりァープチロラ クトンを製造する方法において、触媒として、次 の(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)を使用し、液相で水 素化反応を行なうことを特徴とするャープチロラ クトンの製造法。

- (イ) ルテニウム
- (ロ) 有機ホスフィン
- (ハ) p K a 値 が 2 よ り 小 さ い 酸 の 共 役 塩 基
- (ニ) アルカリ金属の塩化物、アルカリ土類金属 の塩化物、塩化アンモニウム、塩化ホスホニウム、 第1~第3級アミン塩酸塩、第4級アンモニウム 塩酸塩、第1~第3級ホスフィン塩酸塩及び第4 极ホスホニウム塩酸塩からなる群から選ばれる含 塩聚化合物
- 3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はアープチロラクトンの製造法に関する ものである。詳しくはマレイン酸及びノ又は無水 マレイン酸からャープチロラクトンを製造する方 法の改良に関するものである。

(従来の技術)

従来、炭素数4のジカルボン酸類を水素化して ャープチロラクトンを製造する方法については多 数の提案がなされている。例えば触媒として、ニ ッケル系触媒(特公昭43-6947号公報)、コパルト 系触媒(特関昭51-95057号公報)、銅ークロム系触 媒(特公昭38-20119号公報)、銅一亜鉛系触媒(特 公昭 42-14463号公報)等を使用して、固定床又は 懸濁液相により水素化反応を行なう方法が知られ ている。一方、均一系のルテニウム触媒を使用し て上記の水素化反応を行なう方法も知られ、例え ば米国特許3957827号には、[RuXn(PR1R2Ra)xLy] 型のルテニウム触媒を使用し40~400 psiの加圧 下で水紫化してラクトン類を製造する方法が記載 され、また米国特許4485246号には、同様の触媒

による水繁化反応を有機アミンの存在下で行なう ことが記載されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のニッケル系触媒、コバルト系触媒、銅ークロム系触媒、銅ー亜鉛系触媒、毎年が数十気になり、反応条件が数十気にないを使用する従来の方法は、反応条件が数十気によいでは、副生物の分離精製がであり、工業的に必ずしも有利な方法とはでの設定であり、工業的に必ずしも有利な方法とはで使います。一方、上記均一系のルテニウム触媒をで用する従来の方法は、マレイン酸をではその酸無であったなで、では、種かも記載されていない。

本発明は、上記の従来の問題点を解決し、マレイン酸及び/又は無水マレイン酸から、 温和な条件下において高い選択事で効率よく r ー アチロラクトンを製造することを目的とするものである。(課題を解決するための手段)

本発明者等は、上記の目的を達成するために鋭

- 3 -

塩 聚 化 合 物

以下に本発明を詳細に説明する。

本発明に使用されるァープチロラクトン製造用の原料は、マレイン酸又は無水マレイン酸あるいは両者の混合物である。

本発明においては、触媒として、以下に記載する(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)の成分を使用することが必須の要件である。

(イ) ルテニウム:

ルテニウムとしては、金属ルテニウム及びルルテニウム化合物の何れも使用することができる。ルテニウム化合物としては、ルテニウムの酸化物、 「ロゲン化物、水酸化物、無機酸塩、有機酸塩、 な錯化合物が使用され、具体的には例えば、二酸 化ルテニウム、四酸化ルデニウム、二次酸化ルテニウム、 は化ルテニウム、 頭酸ルテニウム、 酢酸ルテニウム 化ルテニウム、 頭酸ルテニウム、 酢酸ルテニウム 化ルテニウム、 頭酸ルテニウム、 酢酸ルテニウム 化ルテニウム、 頭酸ルテニウム、 酢酸ルテニウム のカーテニウム、 酢酸ルテニウム、 ルテーク のカーテニウム 酸ナトリウム、 テトラカルボニル ルテニウム酸 カリウム、 ペンタカルボニル 登検討を狙ねた結果、マレイン酸及び/又は無水マレイン酸を水紊化してァーブチロラクトンを製造する際に、特定の4成分からなるルテニウと多系触媒を使用し、液相で水紫化反応を行なうとを見い出し、本発明に到達したものである。即ち、本発明に到達したものである。即ち、本発明の要は、マレイン酸及び/又は無水マレープを触媒の存在下で水素化することを特徴とする方法において、触媒として、なの(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)を使用し、液相で水紫化反応を行なうことを特徴とする・プチロラクトンの製造法に存する。

- (イ) ルテニウム
- (ロ) 有機ホスフィン
- (ハ) pKa値が2より小さい酸の共役塩基
- (二) アルカリ金属の塩化物、アルカリ土類金属の塩化物、塩化アンモニウム、塩化ホスホニウム、第1~第3級アミン塩酸塩、第4級アンモニウム塩酸塩、第1~第3級ホスフィン塩酸塩及び第4級ホスホニウム塩酸塩からなる群から過ばれる含

- 4 -

ニウム、シクロベンタジェニルジカルボニルルテニウム、ジブロモトリカルボニルルテニウム、クロートリス(トリフェニルホスフィン)ヒドリドルテニウム、ピス(トリーn-ブチルホスフィン)トリカルボニルルテニウム、ドデカカルボニルトリルテニウム、テトラヒドリドデカカルボニルトトラルテニウム、オクタデカカルボニルへキサルテニウム酸ジセシウム、ウンデカカルボニルヒドリドトリルテニウム酸テトラフェニルホスホニウムアドリルテニウム酸テトラフェニルホスホニウムデッドリルテニウムである。これ等の金属ルテニウム及びルテニウム化合物の使用量は通常、反応流過に対象である。

(ロ)有機ポスフィン:

有機ホスフィンは、主触媒である(イ)のルテニウムの電子状態を制御したり、ルテニウムの活性状態を安定化するのに寄与するものと考えられる。有機ホスフィンの具体例としては、トリ-n-ブチルホスフィン、ジメチル-n-オクチルホスフィン等のトリアルキルホスフィン類、トリシクロヘキ

シルホスフィンのようなトリシクロアルキルホスフィン類、トリフェニルホスフィンのようなトリアリールホスフィン類、ジメチルフェニルホスフィンのようなアルキルアリールホスフィン類がなけられる。 有機ホスフィン類が挙げられる。 有機ホスフィンの使用量は通常、ルテニウム1モルに対して、0.1~1000モル程度、好ましくは1~100モルである。また、有機ホスフィンは、それ自体単独で、あるいはルテニウム触媒との複合体の形で、反応系に供給することができる。

(ハ) p K a 値 が 2 よ り 小 さ い 酸 の 共 役 塩 基 :

p K a 値が 2 より小さい酸の共役 塩 茲 は、 触 媒 調 裂 中 又 は 反応 系 中 に お い て 、 p K a 値 が 2 よ り 小 さ い 酸 の 共役 塩 碁 を 生 成 す る も の で あ れ ば よ く 、 そ の 供 給 形 態 と し て は 、 p K a 値 が 2 よ り 小 さ い プ レ ン ス テッド 酸 (プロトン酸)又 は そ の 各種 の 塩 等 が 用 い られる。

具体的には例えば、硝酸、過塩素酸、ホウフッ化水素酸、ヘキサフルオロ燐酸、フルオロスルホ

- 7 **-**

ム、第1~第3級アミン塩酸塩、第4級アンモニウム塩酸塩、第1~第3級ホスフィン塩酸塩及び第4級ホスホニウム塩酸塩からなる群から選ばれる含塩素化合物:

本発明においては、水素化反応の主触媒であるルテニウム触媒の付加的促進剤として、上記の含塩素化合物を使用することを必須の要件とするものであり、これによって比較的温和な条件下で水素化反応を進行させることができると共に、プロビオン酸等の副生物の生成を抑制することができ、目的物の選択性の著しい向上が図られる。

このような含塩素化合物の具体例としては、例えば塩化リチウム、塩化ナトリウム、塩化カリウムは、塩化ルビジウム、塩化セシウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化ストロントウム、塩化パリウム、塩化アンモニウム、塩化ホスホニウム等の塩化物;アニリン塩酸塩、ジエチルアスフィン塩酸塩、トリフェニルホスフィン塩酸塩等のホスフィン塩酸塩;テトラエチルアンモニウム塩酸塩、

これ等の酸又はその塩の使用量は、ルテニウム 1モルに対して0.01~1000モル、好ましくは0.1~ 100モル、更に好ましくは0.5~20モルの範囲である。

(こ) アルカリ金属の塩化物、アルカリ土類金属の塩化物、塩化アンモニウム、塩化ホスホニウ

.- 8 -

ビリジン塩酸塩等の第4級アンモニウム塩;テトラエチルホスホニウム塩酸塩、テトラフェニルホスホニウム塩酸塩等の第4級ホスホニウム塩酸塩等の第4級ホスホニウム塩酸塩等が挙げられる。これ等の含塩素化合物は、反応液中の塩素イオンの濃度として、200~2000 ppmの範囲で使用され、これより多量の塩化物を添加しても、目的物の選択性に大きな改良は認められ

本発明の方法は被相において行なわれ、この際 反応原料または反応生成物でのものを溶媒として 実施することができるが、他の溶媒を使用することができるが、他の溶媒を使用することができるが、他の溶媒を使用するに ジェチルエーテル、アニソール、テトラヒド・ロッ ラン、エチレングリコールジェチルン、メチルルエーテル オキサン、アセトフェーテルスメチルルエール オキサン、アセトフェール、ベンジチル ルケール、エチレングリコール、ベンジグルコール コール、エチレングリコール、カール、エチレングリコール コール等のアルコール類;フェル類;ギ酸酸類

; 酢酸メチル、酢酸 n-プチル、安息香酸ベンジ ル等のエステル類:ベンゼン、トルエン、エチル ベンゼン、テトラリン等の芳香族炭化水素;n-へ キサン、n·オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族 **炭化水安:ジカロロメタン、トリクロロエタン、** クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素:ニトロ メタン、ニトロベンゼン等のニトロ化炭化水素: N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセト アミド、N-メチルビロリドン等のカルボン酸アミ ド; ヘキサメチル燐酸トリアミド、N,N,N',N'-デ トラエチルスルファミド等のその他のアミド類; . N, N'・ジメチルイミダソリドン、N, N, N, N・テトラ メチル尿素等の尿素類;ジメチルスルホン、テト ラメチレンスルホン等のスルホン類:ジメチルス ルホキシド、ジフェニルスルホキシド等のスルホ キシド類;γ-プチロラクトン(目的物)、ε-カ プロラクトン等のラクトン類:テトラグライム、 18-クラウン-6等のポリエーテル類、アセトニ トリル、ベンゾニトリル等のニトリル類;ジメチ ルカーボネート、エチレンカーボネート等の炭酸

- 1 1 -

実施例に限定されるものではない。

実施例 1

200 m1の誘導授拌機付SUS製オートクレープに、ルテニウムアセチルアセトナート 0.08 g(0.2 ミリモル)、トリオクチルホスフィン 0.74 g(2.0 ミリモル)、p-トルエンスルホン酸 0.33 g(1.76ミリモル)、塩化アンモニウム 0.13 g(2.4ミリモル)及びテトラエチレングリコールジメチルエーテル 40 m1を仕込み、水器圧 20kg/cm²で 200℃、2時間加熱処理した。その後、水器圧を 30kg/cm²に上昇させ、テトラエチレングリコールジメチルエーテルに溶解させた 25重量%無水マレイン酸を、ボンブを用いて 24 m1/hrの速度でオートクレープ内に注入し、200℃で 2時間反応させた。その間注入された無水マレイン酸の量は 12.9 g(132.4 ミリモル)であった。

反応終了後、反応液を取り出し分析したところ、 無水マレイン酸の転化率は97.2%、アープチロラクトンと無水コハク酸の合計選択率は97.1%、ア ープチロラクトン単独の選択率は30.9%、アープ エステル類等である。

本発明の方法に従って、マレイン酸及び/又は無水マレイン酸の水素化反応を行なうには、反応容器に、原料物質、前記の触媒成分及び所望により溶媒を養入し、これに水素を導入する。水素は、窒素あるいは二酸化炭素等の反応に不活性なガスで希釈されたものであってもよい。反応温度は通常50~250℃、好ましくは100~200℃である。工業的に実施する場合の反応系内の水素圧は通常0.1~100 kg/cm²、好ましくは1~30 kg/cm²である。反応は回分方式及び連続方式の何れでも実施することができ、回分方式の場合の所要反応時間は通常1~20時間である。

反応終了後、反応生成被から蒸留、抽出等の通常の分離手段により、目的物であるァーブチロラクトンを得ることができる。蒸留残渣は触媒成分として反応系に循環される。

(実施例)

以下本発明を実施例について更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限りこれ等の

- 1 2 -

チロラクトンの収率は30.0%であった。また、ブロビオン酸の選択率は0.7%であった。

比較例 1

実施例 1 において、塩化アンモニウムを添加せず、また無水マレイン酸の量を12.0 g(123.2 ミリモル)とした以外は実施例 1 と同様の操作を行なった。

反応終了後、反応被を取り出し分析したところ、 無水マレイン酸の転化率は98.6%、ァープチロラクトンと無水コハク酸の合計選択率は44.4%、ァープチロラクトン単独の選択率は5.4%、ァープチロラクトンの収率は5.2%であった。また50.8 %の選択率でプロピオン酸が副生していた。

比較例 2

実施例 1 に おい て、 塩化アンモニウムを 添加 せず、 か つルテニウムア セチルア セトナート の代 りに 塩化ルテニウム 3水塩 0・06 g(0・2ミリモル)を用い、 無水マレイン酸の 量を 13・0 g(132・8ミリモル)とした以外は実施例 1 と同様の操作を行なった。

反応終了後、反応被を取り出し分析したところ、

注)CML:熊水マレイン数 、GBL:ァープチロラクトン、 CSC:無水コハク数

無水マレイン酸の転化率は94.1%、 r - ブチロラクトンと無水コハク酸の合計選択率は78.5%、 r - ブチロラクトン単独の選択率は32.3%、 r - ブチロラクトンの収率は30.4%であった。また15.4%の選択率でブロビオン酸が副生していた。

実施例2~実施例7

実施例 1 の方法において、塩化アンモニウム
0.13 gの代りに、表 1 に示す塩化物を使用し、その他は実施例 1 と同様の操作を行なった。

反応終了後、反応液を取り出し分析した。無水マレイン酸の転化率、ァーブチロラクトンと無水コハク酸の合計選択率、ァーブチロラクトン単独の選択率、ァーブチロラクトンの収率並びにプロビオン酸の選択率を表1に示す。

- 15 -

(発明の効果)

表1に示すように、本発明方法によれば、マレイン酸及び/又は無水マレイン酸を液相で水繁化してァーブチロラクトンを製造する際に、特定の成分からなるルテニウム系触媒を使用することによって、温和な条件下、高い透択率で効率よくァーブチロラクトンを製造することができ、その実用上の価値は大きい。

出願人 三菱化成株式会社 代理人 弁理士 木 邑



	4. 格斯克尔 电物	B 43	CML			GBL	GBL	PRA磁
			供給量	転換電	CSC₽	過択略	权帮(%)	式器(%)
	番	浴台牌	8	8	計選択率	8		
		(In mol)			%			
安施四2	塩化リチウム	1.0	12.7	98.4	75.3	28.7	25.7	8.8
実施例3	テトラフェニルホ	9.0	12.8	95.9	85.8	29.6	28.4	8.8
	スホニウム塩酸塩			_				
実施例4	ジエチルアミン	9.0	13.0	98.2	88.6	32.7	31.5	6.3
	植製塩							
実施例5	アニリン塩製塩	9.0	13.1	8.0	83.4	34.5	33.1	9.7
実施例6	アンシン右数右	9.0	13.1	96.0	85.5	38.0	34.6	11.8
実施倒7	塩化アンモニウム	9.0	13.1	97.5	89.6	38.9	37.9	7.6

- 16-